

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА NEXAFS ДЛЯ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МОРФОГРУППОЙ ГРАНИЦЫ ДЛЯ НАНОПЛЁНОК $\text{La}(\text{Y}): \text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.5}\text{O}_1$

Конашук А.С.¹, Филатова Е.О.¹, Лев Л.Л.², Черникова А.Г.², Зенкевич А.В.²

¹ Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург,

Россия

² Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия

e-mail: a.konashuk@spbu.ru, тел.: 8 (931) 577 5476

Повышение величины диэлектрической проницаемости к уже использующимся в производстве диэлектриков без перехода к принципиально новым материалам является актуальной задачей микролитографии. Недавнее открытие эффекта сенетозелектричества в HfO_2 , обеспечиваемого с помощью додирования наноплёнок HfO_2 различными примесями (Al, Si, La, Gd...) [1,2] и/или смешивания HfO_2 с ZrO_2 в различных пропорциях, как раз открывает потенциальную возможность для такого повышения. Поскольку разные кристаллические фазы додированного примесью HfO_2 и твёрдого раствора $\text{HfO}_2\text{-ZrO}_2$ имеют различные значения диэлектрической проницаемости (по отдельности), это обуславливает интерес к тщательным исследованиям, имеющих целью контроль фазового состава наноплёнок $\text{HfO}_2\text{-ZrO}_2$ и повышения величины k . В частности, для сенетозелектриков на основе перовскитов известно [3], что при определённом фазовом составе вблизи так называемой морфотропной границы (МФГ) результатирующее значение каждой кристаллической фазы плёнки может превышать соответствующее значение в поликристаллической фазе в отдельности. В случае успешной реализации МФГ для наноплёнок $\text{HfO}_2\text{-ZrO}_2$ можно ожидать [4] повышения k вплоть до ~50, в то время как метастабильная полярная орторомбическая ($\text{Pca}2_1$) и неполярная тетрагональная ($\text{P}4_2/\text{nmc}$) фазы проявляют (при нулевом электрическом поле) значения $k \sim 30$ и $\sim 35\text{-}40$, соответственно. В связи с этим нами были проведены фазовый структурный анализ наноплёнок $\text{Hf}_x\text{Zr}_{0.5}\text{O}_2$ (HZO), допированных атомами La и Y с концентрациями 0,4, 1,4 мол.% и 0,5-2,6 мол.%, соответственно, с целью нахождения оптимальной концентрации примеси, позволяющей достичь МФГ для пленок HZO.

Пленки $\text{La}(\text{Y}): \text{HZO}$ толщиной 10 нм синтезировались методом ALD при температуре подложки 235 °C (280 °C) [5]. Подложка представляла собой последовательность слоёв $\text{Si-sub/W}(50 \text{ нм})/\text{TiN}(20 \text{ нм})$. На поверхности $\text{La}(\text{Y}): \text{HZO}$ синтезировался методом ALD слой TiN толщиной 20 нм при температуре 400 °C (который в последствии для проведения исследований методом NEXAFS смывался 30% раствором H_2O_2 при температуре 60 °C в течение 10 мин). Дополнительный отжиг готовых тонкоплёночных структур не проводился, так как характерной чертой HZO является кристаллизация при температурах менее 400 °C.

Предварительный анализ с помощью GIXRD подтверждает наличие поликристаллической структуры у всех пленок $\text{La}(\text{Y}): \text{HZO}$ [5]. Основной фазой является орторомбическая $\text{Pca}2_1$ (о-фаза) и/или тетрагональная $\text{P}4_2/\text{nmc}$ (т-фаза). К сожалению, ввиду близости соответствующих межплоскостных расстояний о- и т-фаз, а также длины когерентности, ограниченной толщиной пленок, не

представляется возможным различить с помощью GIXRD присутствие о- и т-фаз в структуре La(Y):HZO. Дополнительно GIXRD показывает наличие незначительных следов моноклинной Р2₁/с м-фазы для 0,4% La:HZO и 0,5% Y:HZO, а для остальных пленок следы м-фазы не выявлены.

Основной методикой получения информации о кристаллическом строении пленок La(Y):HZO был анализ ближней тонкой структуры рентгеновских спектров поглощения (NEXAFS) вблизи Zr M₃-и O K-краёв поглощения. Важно отметить, что для успешного анализа методом NEXAFS не является препятствием близость межплоскостных расстояний для о- и т-фаз HZO. Это обусловлено тем, что формирование ближней тонкой структуры рентгеновских спектров поглощения главным образом происходит внутри ближайшего окружения поглощающего атома за счёт множественного рассеяния фотозелектронной волны на окружающих атомах и её интерференции с первичной волной. В результате форма и положение деталей тонкой структуры высоко чувствительны к малейшим искажениям симметрии ближайшего окружения поглощающего атома, достаточно различающимся для разных кристаллических фаз в случае HZO. В случае т-HZO атомы Hf(Zr) окружены восемью атомами O, ближайшее окружение представляет собой два вложенных друг в друга тетраэдра Hf(Zr)O₄, слегка вытянутых и сжатых вдоль оси с. Для о-HZO и м-HZO ближайшее окружение атомов Hf(Zr) также можно рассматривать как комбинацию всё более сжимающихся/растягивающихся вдоль оси с тетраэдров, соответственно. Были рассчитаны валентные углы O-Hf(Zr)-O с использованием структурных данных [6] и на основе этого в рамках теории кристаллического поля [7] выявлялись детали тонкой структуры, связанные со всеми тремя т-, о-, м-кристаллическими фазами HZO. Измерения рентгеновских спектров поглощения проводились на экспериментальной станции НАНОФЭС синхротрона КИСИ-Курчатов, энергетическое разрешение было не хуже, чем Е/ΔЕ = 1000. Также стоит отметить аддитивность поглощения рентгеновского излучения (поглощают независимо отдельные атомы), благодаря которой был осуществлён количественный анализ относительного содержания т- и о-фаз в пленках La(Y):HZO.

В результате анализа Zr M₃-спектров поглощения подтверждено присутствие следов м-фазы в 0,4% La:HZO и 0,5% Y:HZO, а также оно выявлено для 1,1% Y:HZO (неразличимое при предварительном GIXRD анализе). Также можно сделать важный вывод о незначительном содержании м-фазы по отношению к содержанию о-фазы для всех данных пленок.

Наиболее информативен анализ О K-спектров поглощения. В результате теоретического анализа и изучения формы реперных спектров чистых т-, о- и м-фаз установлены детали тонкой структуры наиболее чувствительные к относительному содержанию т- и о-фаз. Также выявлены детали, однозначно связанные с присутствием т- и м-фаз, анализ которых повышает достоверность делаемых выводов. С помощью подбора линейной комбинации модельных спектров чистых т- и о-фаз были получены относительные содержания т- и о-фаз во всех пленках La(Y):HZO. Проведены корреляции между соотношением содержания т-/о-фаз и электропропицеским откликом нанопленок La(Y):HZO. В частности, показано, что именно при сопоставимом содержании т-/о-фаз ~35%/65%, обеспечиваемом за счёт

среднего уровня допирования около 1 мол.% как атомами La, так и Y, достигается максимум величины диэлектрической проницаемости $\kappa=45$, превосходящий значение для чистой т-фазы. Таким образом, метод NEXAFS был успешно применён для демонстрации возможности достижения МФГ для нанопленок La(Y)HZO. В дальнейшем планируются *operando* исследования кристаллического строения пленок La(Y)HZO на различных этапах сегнетоэлектрического циклирования.

1. Böseke T.S., Müller J., Bräuhaus D., Schröder U., Böttger U., *Applied Physics Letters*, 2011, 99, 102903
2. Chernikova A.G., Kuzmichev D.S., Negrov D.V., Kozodaev M.G., Polyakov S.N., Markeev A.M., *Applied Physics Letters*, 2016, 108, 242905
3. Ahari M., Somayazulu M., Cohen R.E., Ganesh P., Dera P., Mao H.K., Hemley R.J., Ren Y., Liemann P., Wu Z., *Nature*, 2008, 451, 545-548
4. Jung M., Gaddam V., Jeon S., *Nano Convergence*, 2022, 9, 44
5. Kozodaev M.G., Chernikova A.G., Korostylev E.V., Park M.H., Khakimov R.R., Hwang C.S., Markeev A.M., *Journal of Applied Physics*, 2019, 125, 034101
6. Materials Project, <https://next-gen.materialsproject.org/>
7. Albright T.A., Burdett J. K., Whangbo M.H., *Orbital Interactions in Chemistry*: Second Edition; John Wiley and Sons: Hoboken, 2013.